Review 5. レーザ光の特長を活かした特殊加工



水ガイドレーザによる ダイヤモンド金型部品の精密加工

岩井

学*

M. Iwai

1. はじめに

耐久性の向上を目的に金型部品や切削工具へのダイヤ モンド素材の適用が多く行われている.化学気相成長 (CVD)法によって超硬合金や工具・金型鋼の表面にダイ ヤモンド被覆を行う用途は多く,CVD法は複雑な工具 や金型形状に対応し易い特徴を持っている.現在,市販 されているCVDダイヤモンド被覆工具の表面粗さは最 高品質のものでRz=1~2µm¹⁾と言われているが,加工 面品位を向上させるにはダイヤモンド被覆の表面粗さを より向上させる必要がある.また,ダイヤモンド焼結体 (PCD)も硬度,化学的安定性に優れており,切削工具の 他,プレス金型部品として摩耗が激しい部位への組み込 みや耐摩耗材として用いられている.PCDへの形状創成 加工は放電加工によって行われるが,複雑で曲面を有す る箇所の仕上げ加工には課題が残されている.

CVD ダイヤモンド表面の表面粗さを向上させる方策 としては、1) ダイヤモンドの成長条件制御による結晶粒 塊微細化、2) 微粒ダイヤモンド砥石による研削、3) ダイ ヤモンド砥粒によるラッピング、4) 特殊金属材料などと の熱化学反応法、5) 高調波 YAG レーザ照射法、6) ピコ 秒レーザ照射による蒸発法などが提案されているが、装 置価格、加工コスト、加工時間、特に複雑形状への対応 が困難であるなどの問題があり、1) の結晶粒微細化法以 外は何れも実験段階に留まっているのが現状である.

既存 YAG レーザによる CVD ダイヤモンド膜の表面 粗さ向上に関する研究としては、吉川、戸倉ら²⁾ や安 永、鈴木ら³⁾ はダイヤモンド膜表面とほぼ平行(照射角 0=80~89°)にレーザを照射する場合のみ CVD ダイヤモ ンド成長面上の突起部を選択的に除去し、表面性状を向 上できることが報告されている.しかし、ダイヤモンド 膜表面に対しほぼ平行にレーザを照射する方法では複雑 形状を有するドリルやエンドミルへの適用は容易ではな い.

著者らは数10~100µmの微細ノズルから高圧(10MPa~) で噴射される細い水柱の内部にレーザを閉じ込めて加工 点まで導く水ガイドレーザ⁴⁾(図1)をダイヤモンド類の 微細加工に応用する研究⁵⁾を行ってきた.水ガイドレー ザはノズル先端部からの距離が数10mmの範囲において ビーム径およびエネルギー密度が変わらないため,凹凸 のある立体形状に対しても加工できること,レーザ照射 点近傍を常に高圧水で冷却しているため照射面の熱変質 がきわめて少ない特徴も併せ持っている.また,水ガイ ドレーザに使用されているレーザ波長帯域(*λ*=532nm) はダイヤモンドの除去に適していると言われている³⁾.

本研究では,数10mmに及び同一のビーム形状やエネ ルギー密度を持ち,照射面に発生する熱を瞬間的に除去 できる特徴を有する水ガイドレーザを用いて CVD ダイ ヤモンド膜の結晶凸部のみを図1のように選択的に除去 し,結果として面性状を向上させることを目的としてい る.本報告では CVD ダイヤモンド厚膜の結晶成長面お よび PCD 表面の加工状況を調べた.



図1 水ガイドレーザによるダイヤモンド膜 凹凸の推定除去機構

2. 実験方法

実験装置および条件を**表1**に示す. CVD ダイヤモン ド厚膜の結晶成長面(初期粗さ*Rz*=60µm)および PCD 表面への水ガイドレーザの照射実験は**図2**のように行っ た.水ガイドレーザ径100µm,加工点と水ガイドレーザ 照射口の間隔*Cl*=20mm,レーザ出力(実効値)*Pe*=30W, 周波数15kHz,パルスオン時間100nsとした.走査速度 は*F*=10m/min である.

表1 実験装置および条件

加工機	水ガイドレーザ機 (Waterbeam Machine, スギノマシン) LD 励起レーザ, λ=532nm (2 倍波)
ダイヤ	 · CVD ダイヤモンド厚膜 (5×8×t0.5mm)
モンド	(CVDITE-CDM, 未研磨, エレオントシックス) · ダイヤモンド焼結体 (PCD, 5×8×t0.5mm)
試料	(原料ダイヤ径: 10µm, 25µm, エレオントシックス)
レーザ 条件	レーザ出力(実効値):P _e =30W 水ガイドレーザ径:φ100µm,周波数:15kHz パルス幅:オン時間 100ns,オフ時間 66µs
照射	照射角: <i>θ=</i> 0, 70°, 走査速度: <i>F</i> =10m/min
条件	間隔: <i>Cl</i> =20mm, オーバーラップ:50µm







(a) 加工領域

(b) 加工領域の加工深さ (A-A 断面)

A - A

0.2mm

50µm



図4 CVD ダイヤモンド厚膜結晶面へのレーザ照射角度と加工性能の関係 (Pe=30V)

3. 各種ダイヤモンド試料への照射結果

3.1 CVD ダイヤモンド厚膜の表面加工

(1) 既存 YAG レーザによる加工性能

比較のため既存 YAG レーザ機 (ML-2350AF, ミチテ クノス)にて照射を行った.スポット径 φ0.2mm に対し 50µm ずつオーバーラップさせながら4 ピッチ分スキャ ン照射した (図3).大気中で,かつレーザ条件 (*Pe*=1kW, *te*=1ms) が異なるが, CVD ダイヤモンド表面に加工跡が 深く入り,周囲が黒く焦げていた.

このことから、ダイヤモンド結晶凸部の平滑化には適

さないと思われる.

(2) 照射角と加工性能の関係

レーザ出力 Pe=30W で水ガイドレーザを垂直方向 ($\theta=0^{\circ}$)および斜め方向($\theta=70^{\circ}$)から照射し, F=10m/minで走査した結果を図4に示す.垂直照射($\theta=0^{\circ}$)では1 パスの走査でダイヤモンド結晶凸部が除去されていた. 斜め照射($\theta=70^{\circ}$)では加工能率の低いため5パス走査し た結果,広い溝幅でダイヤモンド結晶凸部が除去されていた.

(3) スキャン照射回数と加工性能



図5 CVD ダイヤモンド厚膜結晶面の平滑加工



図6 スキャン照射における加工深さと表面粗さの変化

図2(c)のようにレーザ径 φ100µm に対し50µm ずつ オーバーラップさせながら10パス走査するスキャン照 射の施行回数と加工性能の関係を調べた(図5).スキャ ン照射回数が増えると加工深さは増大し、スキャン照射 10回後では70µmの深さに達した(図6(a)).表面粗さ は初期面粗さ*Rz*=60µm に対し、スキャン照射10回後で はSEM 観察結果からもダイヤモンド結晶凸部が滑らか になっているのが分かり、*Rz*=19µm に改善された(図 6(b)).

3.2 PCD の表面加工

放電加工により表面を荒らした PCD に対し,水ガイド レーザをスキャン照射した結果を図7に示す.初期表面 粗さ *Rz*=25μm に対しスキャン照射を10回行うと,原 料ダイヤ粒径10μmの PCD では*Rz*=4.6μm,粗粒ダイヤ 25μmの PCD では*Rz*=11μm にそれぞれ改善された.

4. おわりに

水ガイドレーザによるダイヤモンド金型部品の精密加 工を実現するため、CVDダイヤモンド膜および PCD の 加工性能を調べた.

(1) CVD ダイヤモンド膜の結晶成長面に垂直照射した



図7 PCD へのスキャン照射(10回)後の表面性状

結果,結晶成長面凸部が除去され表面を平滑化できることが分かった.また,CVDダイヤモンド膜に対し,斜め方向から照射すれば一度に広い面積を平滑にできた. (2) PCD表面も原料ダイヤモンド粒径に寄らず平滑化できた.

今後, PCD 金型に適用するため,加工量を制御し,表 面粗さを良くするための加工条件の最適化を実験的,か つ理論的に行う必要がある.また,摩耗評価を行う予定 である.

謝辞

本研究を行うに当たり,貴財団より助成していただきま したことに対して,厚く御礼申し上げます.

参考文献

- 羽生博之他:超微結晶ダイヤモンドコーティング工具 による MMC 加工,日本機械学会 2001 年度年次大会 講演論文集(Ⅲ) p.287.
- 2) 手塚,吉川: YAG レーザ照射によるダイヤモンド粒 の切断,精密工学会誌,55,10(1989)1863.
- 3) 安永,鈴木他:Nd:YAG レーザ第5高調波照射による CVD ダイヤモンド膜の表面性状改善,2007 年度精密 工学会春季大会講演論文集(2007)767.
- (㈱スギノマシン:製品カタログ「ウォータービームマシン」.
- 5) 岩井、二ノ宮、鈴木他:ウォータービーム(水ガイドレーザ)による超砥粒砥石の精密成形の試み、電気加工学会全国大会(2010) 講演論文集(2010) 41.